文章编号:1002-2082(2007)05-0582-05

微通道板(MCP)电子清刷用电子枪的设计

程宏昌,石峰,候志鹏,师宏立,史鹏飞

(微光夜视技术国防科技重点实验室,陕西 西安 710065)

摘 要:为了满足 Φ_{30} mm MCP 大束流短时间电子清刷新工艺要求,以轴向电子枪工作原理为 基础,利用静电场对电子的作用理论,分析了电子的运动轨迹,并对电子的偏转进行了计算。根据 计算结果,设计了电子枪的基本结构,确定了电子枪的各种参数:灯丝材料为 $\Phi_{0.05}$ mm 的钨 (75%)铼(25%)合金丝;灯丝形状为"V"字型;电子枪外径为 Φ_{35} mm,高度为20 mm,最大加热功 率为 12.6 W 时,电子发射电流密度达到 1.26×10⁻⁵ A/cm²。用该电子枪对4块性能相近的 Φ_{30} mm MCP 电子清刷4 h 后, MCP 的增益值达到 500±50。这表明:用新电子枪可以代替原 RUS-A 型电子枪。

关键词:微通道板(MCP);电子清刷用电子枪;电子枪灯丝 中图分类号:TN223 文献标志码:A

Design of electron gun for scrubbing microchannel plate

CHENG Hong-chang, SHI Feng, HOU Zhi-peng, SHI Hong-li, SHI Peng-fei (Key Laboratory for Low Light Level Technology of Commission of Science Technology and Inclastry for National Defense, Xi'an 710065, China)

Abstract: In order to have great electron flux for scrubbing Φ 30 nm microchannel plate and complete the process in less time, the trace of electron was analyzed and the electron deflection was calculated, according to the operation principle of the axial electron gun and the theory of the function of electrostatic field on electron. Based on the calculation result, the structure of the new electron gun was designed and all the parameters of the electron gun were determined, the filament material was Φ 0.05 mm tungsten rhenium alloy(75%, 25%), the filament was in "V" type, the radius of the electron gun was Φ 35 mm and its height was 20 mm, and the current density of electron emission reached 1. 26×10^{-5} A/cm² while the maximum filament heating power was 12.6 W. The gain of the four microchannel plates reached 500 ± 50 after being scrubbed with the electron gun for four hours. The result indicates that the old electron gun RUS-A can be replaced by the new one with better performance.

Key words: microchannel plate (MCP); electron gun for electron scrubbing; filament of electron gun

引言

微通道板^[1](MCP)电子清刷是微光像增强器 研制中的关键工序之一,它是在真空系统中用电子 束轰击微通道板,达到对微通道板除气、调节增益 和降低噪声等目的。性能参数不同的MCP 需要不 同的电子清刷工艺,不同的 MCP 电子清刷^[2]工艺, 需要相应强度的电子束流和电子清刷时间,不同强 度的电子束流需要不同的电子枪来提供。根据Φ30mm MCP 电子清刷新工艺要求,Φ30 mm MCP 通 过4 h 的电子清刷达到原工艺24 h 的清刷效果,这

收稿日期:2007-05-04; 修回日期:2007-06-18

作者简介:程宏昌(1974-),男,陕西高陵人,工程师,主要从事微光夜视成像器件工艺研究工作。E-mail:chh600@163.com

要求电子枪的最大发射电流密度为 1.2×10^{-5} A/ cm²。目前使用的RUS-A 电子枪是轴向电子枪,其 电源加热最大功率为 13.2 W,安装在直径为 Φ 35 mm,高为 30 mm 的真空空间,最大电流密度 为 1.9×10^{-6} A/cm²,可见,它无法满足 Φ 30 mm MCP 电子清刷新工艺要求。因此,需要一种电流密 度为 1.2×10^{-5} A/cm²,其余 2 个参数不变的新电 子枪代替。因国内、外轴向电子枪产品较少,加之, 灯丝最大功率为 13.2 W 的灯丝亦很少。本文在电 子枪工作原理的基础上,以灯丝的加热功率、电子 枪发射电流密度以及电子枪的总体尺寸 3 个要求 为设计目标开展电子枪的设计制作。

1 电子枪工作原理

通常将产生加速及会聚高能量密度电子束流 的装置称为电子枪^[3]。根据枪体结构不同,可分为 近距环枪、远距环枪、横向枪、轴向枪等,可用于 MCP电子清刷并能产生强束流的只有轴向枪了。 在轴向枪中,又可以分为直热式阴极电子枪和间热 式阴极电子枪2种。其中直热式阴极电子枪和间热 式阴极电子枪2种。其中直热式阴极电子枪的丝状 阴极可直接通电加热发射电子束,适用于小功率的 电子枪;间热式阴极电子枪发射电子束的阴极通常 做成块状,由另一个灯丝加热阴极间接加热,它适 用于大功率的电子枪。本文提供的电子枪的最大功 率为13.2 W,体积(直径*Φ*35 mm,高20 mm)也很 小。因此,选用直热式阴极灯丝轴向电子枪的基本 结构,其工作原理如图1所示。



- 图1 直热式轴向电子枪工作原理图
- Fig. 1 Working principle of directly-heated axial electron gun

从图1可见,该电子枪由灯丝、灯丝电源、偏转 电阻、负偏高压和阴极屏蔽罩5部分构成。它们的 功能和作用如下。

1.1 灯丝

因灯丝工作于负电位,故又称为阴极灯丝。电

子枪工作时灯丝处于高温状态,它向真空系统发射 电子。灯丝材料和灯丝直径对灯丝加热功率、灯丝 发射电流密度有着决定性的作用。

1.2 灯丝电源

提供灯丝工作时的恒定电压和电流,保证灯丝 正常工作。

1.3 偏转电阻

用于调节灯丝工作时的电流值,在灯丝电源与 灯丝工作电流匹配较差时使用。

1.4 负偏高压

它可使发射到真空中的电子发生偏转并向阳 极加速运动,到达 MCP 时具有一定能量。

1.5 阴极屏蔽罩

用于限制真空系统中电子加速方向直线运动 的电子束流,使之达到一定的束斑。

2 电子枪设计

2.1 设计思路

在直热式轴向电子枪工作原理的指导下,根据 静电场对电子的偏转和加速作用,对电子的运动轨 迹进行计算。根据计算结果和工作经验设计了电子 枪的基本结构和灯丝材料,并用实验方法确定灯丝 直径,最后对该电子枪的性能进行了实验验证。

2.2 电子枪灯丝形状的确定

电子枪灯丝形状有:"∨"字型、"Z"字型、蚊香 型和"—"字型等多种形式,本文根据加工工艺的难 易程度以及设备内部状况,决定选用"∨"字型灯丝。 2.3 电子枪设计

电子枪设计是在电子枪灯丝形状确定的基础 上,设计电子束聚焦结构,从而设计出适用的电子 枪。根据直热式轴向电子枪工作原理可知,该电子 枪是利用静电场的作用实现电子的偏转和聚焦的, 使电子束能够均匀地达到 MCP 表面,实现对 MCP 的电子清刷。该电子枪的电子运动轨迹见图2。



图 2 电子运动轨迹示意图

Fig. 2 Schematic diagram of electron moving path

由图2可见,当给灯丝通电达到灯丝的发射温 度后,它将向各个方向发射电子,而安装在阴极屏 蔽罩内的灯丝与阴极屏蔽罩处于等电位,向水平方 向发射出电子运动到阴极屏蔽罩上时,会在静电平 衡作用下被吸收掉。与水平方向有一定夹角的电子 束,有的射出阴极屏蔽罩孔,在加速电场的偏转作 用下向MCP(阳极)运动;向竖直方向发射的电子 会受到阴极屏蔽罩的限束作用,只有孔径为 $\Phi_{4 \text{ mm}}$ 的阴极罩孔的电子束会在加速电场作用下 向 MCP 运动。在阴极屏蔽罩限束孔径、阴极与 MCP 之间距离确定的条件下,可通过控制阴极屏 蔽罩与 MCP 之间的相对电势,达到控制这几部分 电子,使它们以一定量到达MCP表面。整个过程中 电子束的最大偏转情况可以通过图 3 所示的示意 图进行计算。图中a为阴极屏蔽罩的长度,d为阴 极屏蔽罩的聚焦孔半径, A 为最大偏转电子束的 反向延长线与电子枪中心的夹角, v 为偏转电子 束在阴极屏蔽罩聚焦孔处竖直方向的位移,D为 电子竖直方向的最大位移, L1 为聚焦孔到 MCP 面的水平距离,L2为偏转电子束中心到 MCP 的 水平距离。此电子枪的电子聚焦偏转方式是利用2 个平行平静电场使电子束偏转,最终使一定范围平 面电极上的电子束达到均匀。





在工作中,将阴极屏蔽罩作为电子束的限流装置,对其出射电子进行限束,在阴极屏蔽罩下方的 平面和 MCP 两个平面平行板加上恒定的电压U, 就构成了一个电子偏转的静电场。根据静电场理 论,电子在竖直方向的运动方程^[5]可以写成:

$$m \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = m \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = eE_y \tag{1}$$

忽略边缘效应,就可认为平行板间电场强度是 恒定的并等于U/d,(U 是平板间的电位差,d 是板 间距离)。将(1)式积分,就可以找出平板电场出口 处电子在竖直方向的位移数值,即

$$y_1 = \frac{1}{4} \frac{a^2}{U_a} \frac{U}{d} \tag{2}$$

式中: *a* 为阴极屏蔽罩的长度; *U_a* 为电子枪中 MCP 表面的电压。电子离开偏转作用区域时的偏 转角可以由下式确定:

$$\tan A = \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}\right)_{z=a} = \frac{1}{2} \frac{a}{U_a} \frac{U}{d} \tag{3}$$

电子束到达MCP 表面上的位移由偏转板间的 位移和偏转板到 MCP 的空间位移两部分叠加而 成。第二项为*L*1•tan*A*,其中*L*1为阴极屏蔽罩到 MCP 表面的距离。于是,MCP 表面电子的最大位 移为

$$D = y_1 + L1 \cdot \tan A = \frac{1}{2} \frac{a}{U_a} \frac{U}{d} + \frac{1}{4} \frac{a^2}{U_a} \frac{U}{d} (\frac{a}{2} + L1)$$
(4)

$$\square D = \frac{a(\frac{a}{2} + L1)}{2U_a d} U \tag{5}$$

由此可见,在其他参数确定的条件下,电子束 的偏转位移与2个电极之间的电压成正比。通过控 制2个电极之间的电压达到控制电子束的偏转,从 而使不同能量的电子到达MCP表面。据此原理,在 设计时首先根据经验值确定一个基本结构,然后通 过实验验证基本结构的具体尺寸,并根据验证结果 进行修改。设计结果是:灯丝有效长度为45 mm,总 长度为 60 mm,"∨"字型结构,设计的电子枪灯丝 结构如图 4 所示(图中尺寸为 mm)。



图4 电子枪灯丝结构图

Fig. 4 Structure of filament for etectron gun

电子枪阴极罩选用无磁不锈钢材料制作,其目 的是控制电子束发射方向。另外,给其施加负偏压, 从而使逸出电子在真空中运动时具有足够能量,使 之到达MCP 表面时能够实现对MCP 清刷除气,其 结构如图 5 所示。

将电子枪灯丝和阴极荫罩按照图 6 所示装配 成电子枪系统,装配时保证灯丝的下沿与阴极荫罩 相平,以保证电子束的大小;另外灯丝的 2 个冷端 一端与阴极荫罩接通,另一端通过陶瓷与阴极屏蔽 罩绝缘,以保证电子枪系统的正常工作。



• 585 •



图 5 电子枪阴极荫罩结构图





图6 电子枪结构图

Fig. 6 Structure of electron gun

2.4 电子枪灯丝材料的选择

在直热式阴极中,用于电子枪灯丝的材料通常 为W,Ta,Mo 或W,Mo 与其他金属的合金,它们一 般具有高熔点、低逸出功、小蒸发率、低热导率、良 好的电导率及化学稳定性。其性能见表1 所示。

表1 电子枪灯丝材料性能表

 Table 1
 Performance of filament materials

for electron gun

参数	钨(W)	钼(Mo)	钽(Ta)	铼(Re)
逸出功/eV ^[4]	4.52	4.24	4.13	5.1
熔点 /℃	3 410	2 625	2 996	3 167
热导率 /J •cm ⁻¹ •s ⁻¹ •K ⁻¹	0.31	0.382	0.130	
蒸发率 1000℃/g・cm ⁻² •s ⁻¹	10^{-24}	2×10^{-17}	_	
电导率 (Hg=1)	18	20	6	4.6

从表1可见,钽的逸出功和热导率最小,易于 在较小功率下获得较大的电子束流,但是它的电导 率很差,因此要实现光电发射需要的加热功率很 大,故钽不是优先选用的材料。

比较钼和钨可见,钼蒸发率是钨的10⁷倍,因 钼不适合在超高真空室中制作电子枪,故选用钨丝 比较合适。但由于纯钨不好定型,细的钨丝加工成 型后,通过电流受热时会出现下垂现象,造成电子 分布不均匀甚至灯丝短路,造成无法正常工作。当 在高温钨中添加铼的合金时,能够消除这种现象, 据此选用75%钨和25%铼形成的合金作为电子枪 灯丝材料。

2.5 电子枪灯丝直径的确定

灯丝直径对饱和电流和电子发射密度影响极大,同时也决定着灯丝的加热功率。实验时选用直径:1.0 mm,0.8 mm,0.5 mm,0.3 mm,0.1 mm,0.05 mm 6 种规格灯丝制成有效长度为45 mm 的灯丝,在10⁻⁶Pa 的真空环境中,用最大加热功率为13.2 W 的原电子枪灯丝加热电源进行灯丝加热功率实验,实验结果如表2 所示。

表2 灯丝加热功率实验数据

Table	2	Experiment	data	of	filament	heating	nower
rable	4	Experiment	uata	UI.	mament	neating	power

<mark>规格</mark> Φ/mm	灯丝加热 功率/W	中心发光 尺寸/mm	现象	用/否
1.00	13.2	9	发红	否
0.80	13.2	15	微弱亮光	否
0.50	13.2	21	亮光稍强	否
0.30	13.2	27	亮光稍强	否
0.10	13.2	33	亮光稍强	否
0.05	9.6	45	发红	用
0.05	10.2	45	发亮光	用
0.05	10.8	45	亮光变强	用
0.05	12.0	45	光强且刺眼	用

从表2 可见,直径0.05 mm 的灯丝能够满足灯 丝加热功率要求,可以作为选择对象;另外,灯丝的 有效长度可以确定为 45 mm。

3 工艺实验及结果分析

3.1 电子枪发射电流密度实验及结果分析

发射电流密度是电子枪的一个重要参数,电子 发射饱和电流密度由下面的经验公式来描述:

$$j_s = kT^2 \exp\left(\frac{-11610u}{T}\right) \mathrm{A/cm^2}$$
(6)

式中:k为里查逊常数且k=120 A/(cm²·K);T为电子枪灯丝的热力学温度;u为阴极材料的逸出功。

由(6)式可见,电子枪发射的电流密度由电子 枪灯丝材料和电子枪工作时的温度来决定。在电子 枪材料及灯丝的尺寸确定后,电子枪工作时的温度 由加热功率决定,加热功率越大,相同的电子枪灯 丝工作时温度越高,其发射电流密度就越大。该值 可以间接地用单位面积MCP 输入面上收集到的电 流来表征。

为对比新旧电子枪性能,按照通常的制管工艺 进行真空排气,测量了各种加热功率下 MCP 收集 到的电流大小,以此来表征电子枪发射的电子束流 密度。测量结果如表3 所示。

表 3 不同加热功率下电子枪发射束流密度的测量结果

 Table 3
 Measured results of beam current density emitted

 by electron gun at different heating power

灯丝加热功率/W	电流/μA	电流密度/ $\mu A \cdot cm^{-2}$
10.2	20	2.8
10.8	30	4.5
11.4	60	8.4
12.0	70	9.8
12.6	90	12.6
13.2	100	14.0

从表 3 可见,该电子枪在加热功率为 12.6 W 时,电子发射电流密度大于 1.2×10⁻⁵ A/cm²,在加 热功率最大即 13.2 W 时,其电子发射束流密度已 达到 1.4×10⁻⁵ A/cm²,该值完全满足工艺要求。

3.2 MCP 电子清刷实验

• 586 •

电子枪的发射性能通常用MCP 清刷效果来衡量,MCP 电子清刷效果用电子清刷后增益的高低 来表征。本次实验选取8块性能相近的MCP,其中 4块用原RUS-A型电子枪,另外4块用新研制的电 子枪进行清刷对比实验,实验结果如表4所示。

表 4 2 种电子枪电子清刷微通道板(MCP)的实验数据

 Table 4
 Experimena data of MCP scurbbed by both old and new electron guns

MCP 序号	电子枪	清刷后 MCP 增益	工艺时间 /h	灯丝最大加 热功率/W
BA6041-128-30	新	528	4	12.6
BA6231-098-36	旧	554	24	13.2
BA5063-061-40	新	492	4	12.6
BA5063-061-27	旧	508	24	13.2
BA6039-050-34	新	536	4	12.6
BA5063-061-31	旧	518	24	13.2
BA6031-098-36	新	508	4	12.6
BA6053-149-30	旧	526	24	13.2

从表4 可见,采用新、旧2 种电子枪对微通道板 (MCP)进行电子清刷,在性能对比时,新、旧电子 枪灯丝工作的最大加热功率分别为 12.6 W 和 13.2 W,新电子枪灯丝加热功率小于旧电子枪灯 丝加热功率,但能满足设备需要;另外利用新电子 枪对微通道板电子清刷时仅需4h就能达到旧电 子枪24h同样的效果,使微通道增益控制在500± 50 范围内,满足了微光像增强器研制工艺要求,大 大缩短了 MCP 电子清刷时间。

4 结束语

设计了一套灯丝材料为钨铼合金丝的" \lor "型 灯丝结构,直径为 Φ 35 mm,高为20 mm 的电子枪, 并对设计的基本结构和性能进行了实验验证。结果 表明:灯丝加热功率为 12.6 W 时,发射电流密度 为 1.2×10⁻⁵ A/cm²;用该电子枪对 Φ 30 mm MCP 电子清刷4 h 后, MCP 的增益值达到 500±50,达 到了原 RUS-A 电子枪 24 h 的清刷效果,缩短了 MCP 电子清刷时间,可满足 Φ 30 mm MCP 大束流 短时间电子清刷工艺的要求。

参考文献:

- [1] 杨青,陈烽,侯洵.微通道板电子传输时间特性的理论 分析[J].应用光学,2006,27(6):535-538.
 YANG Qing, CHEN Feng, Hou Xun. Theoretic analysis of channel electron time character [J]. Journal of Applied Optics, 2006,27(6):535-538. (in Chinese)
- [2] 潘京生,苏德钽,刘术林,等.一种成分优化的微通道 板[J].应用光学,2007,28(1):16-19.
 PAN Jing-sheng, SU De-tan, LIU Shu-lin, et al.
 Microchannel plate with optimized glass composition
 [J]. Journal of Applied Optics, 2006,27(6):535-538. (in Chinese)
- [3] 张以忱.电子枪与离子束技术[M].北京:冶金工业出版社,2004:44-46.

ZHANG Yi-chen. Electron gun and ion gun technology [M]. BeiJing: Melallurgical Industry Press,2004:44-46. (in Chinese)

- [4] 真空电子器件编写组.真空电子器件材料[M].北京: 电子工业出版社,1984:17-20.
 Vacuum Electron Devices Writen Group. Vacuum electron devices material [M]. BeiJing: Electron Industry Press,1984:17-20. (in Chinese)
- [5] 暮良洛夫 м я. 电子束器件[M]. 北京:国防工业出版 社,1962:53-87.
 МУЛЯРОВ М Я. Electron beam device [M]. BeiJing: Defense Industry Press,1962:53-87. (in Chinese)